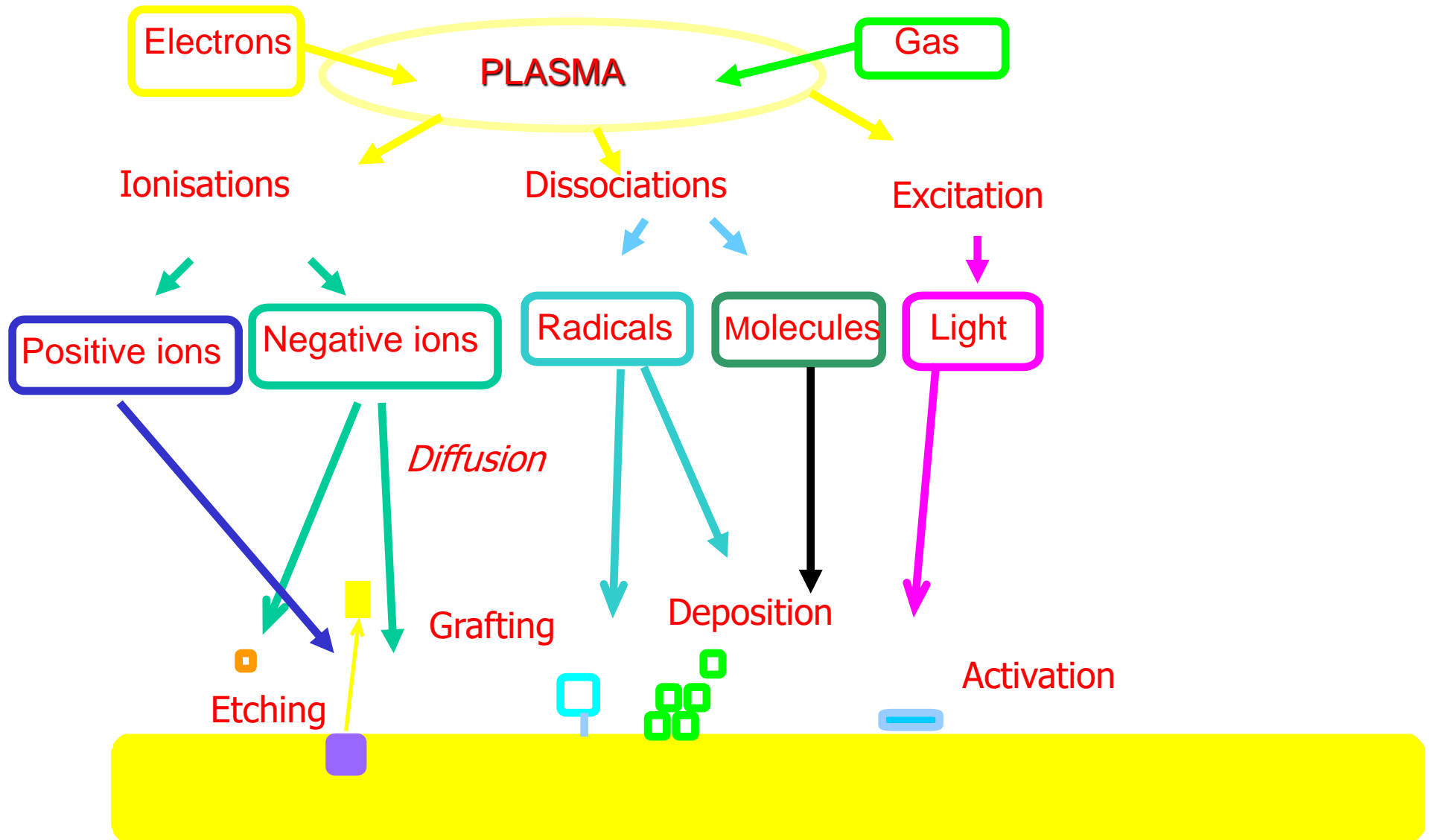


# Tecnologia a Plasma

## Funzionalizzazione di superfici



# Richiami di teoria

Fridkin

Plasma Chemistry

# Attività 1

## Trattamenti a plasma

- **Modificazione di un materiale esposto a un plasma RF**

Obiettivi: Analisi di processi di etching/grafting/deposition  
Dipendenza dai parametri della scarica elettrica

# Attività 2

## Trattamenti a plasma

- **Misura dell'energia superficiale**

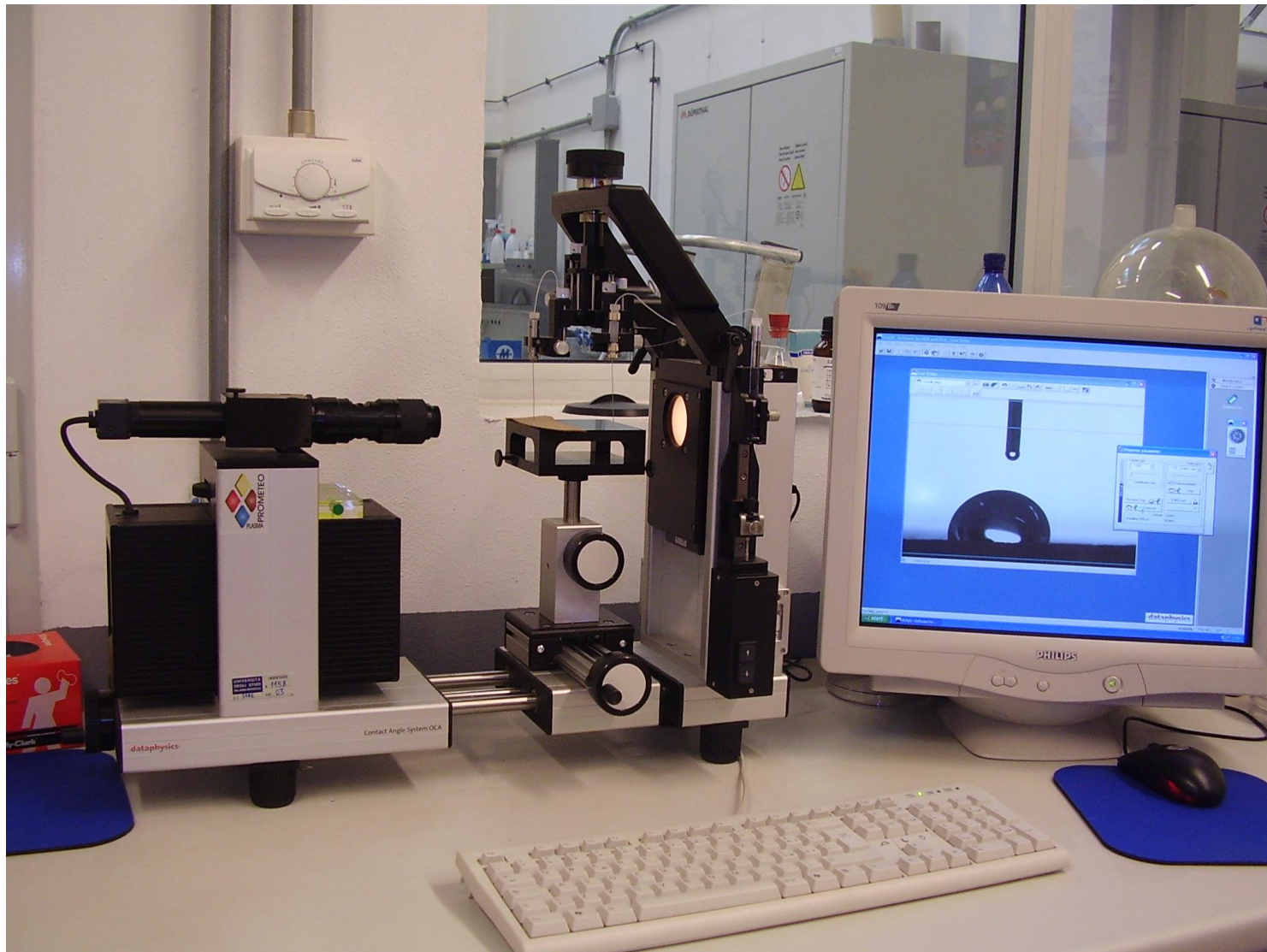
Obiettivi: Misura dell'angolo di contatto (acqua/liquidi)

Misura dell'energia superficiale del materiale

Confronto con materiale tal quale

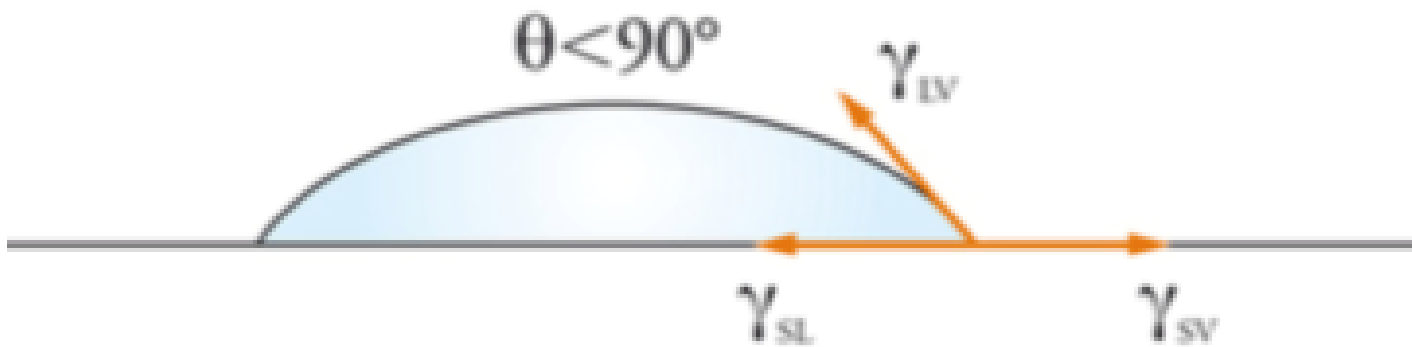
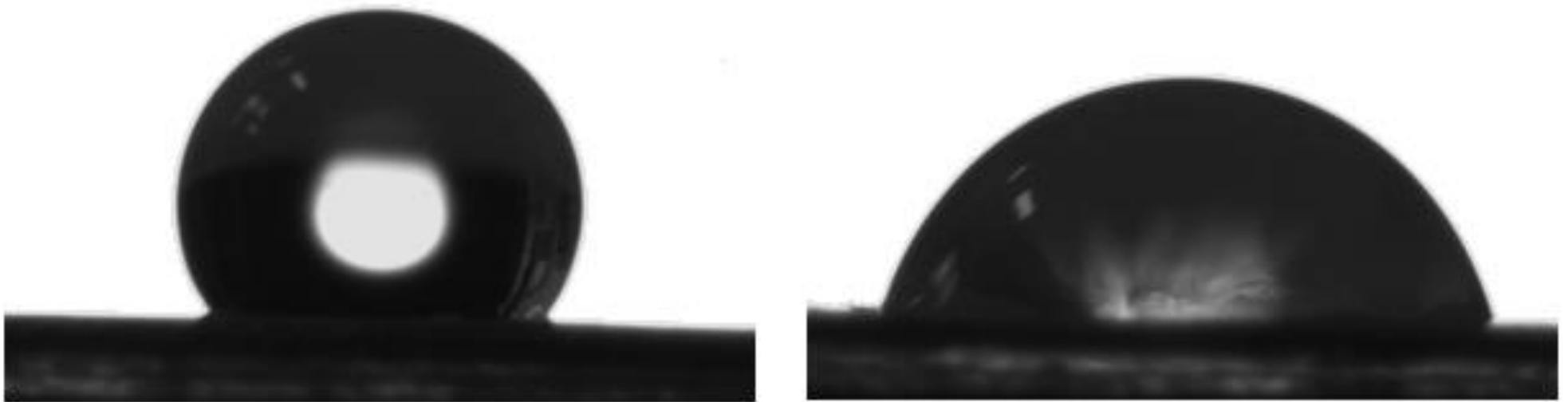
# Setup Sperimentale

## Angolo di Contatto

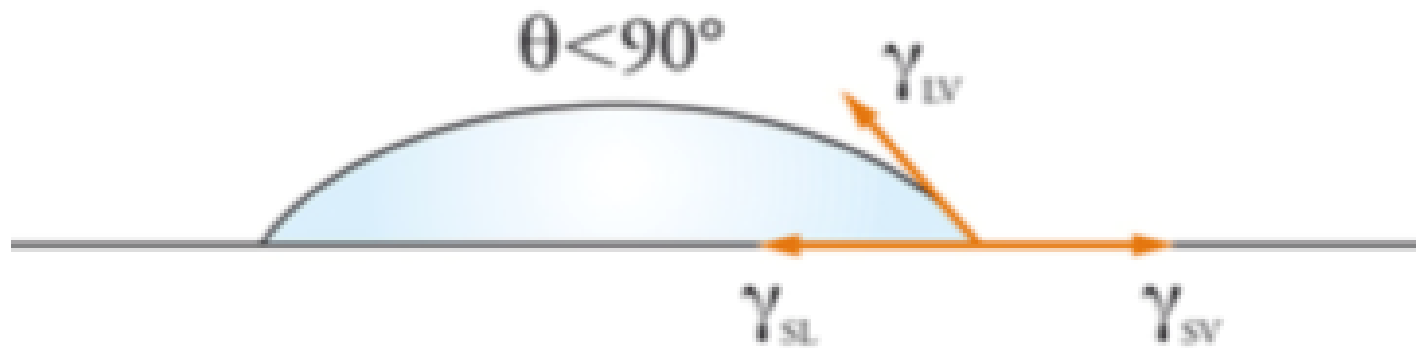


# Setup Sperimentale

## Angolo di Contatto



# Richiami di teoria



$$\sigma_s^D = \frac{\sigma_L (\cos \theta + 1)^2}{4}$$